【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成17年7月28日(2005.7.28)

【公開番号】特開2001-224926(P2001-224926A)
【公開日】平成13年8月21日(2001.8.21)
【出願番号】特願2001-16497(P2001-16497)
【国際特許分類第７版】
　Ｂ０１Ｄ　53/86
　Ｂ０１Ｊ　21/04
　Ｂ０１Ｊ　21/06
　Ｂ０１Ｊ　21/08
　Ｂ０１Ｊ　23/06
　Ｂ０１Ｊ　23/10
　Ｂ０１Ｊ　23/14
　Ｂ０１Ｊ　23/42
　Ｂ０１Ｊ　23/745
　Ｂ０１Ｊ　23/75
　Ｂ０１Ｊ　23/755
　Ｂ０１Ｊ　27/043
　Ｃ０１Ｂ　 7/19
　Ｃ０１Ｂ　17/45
　Ｃ０１Ｂ　21/083
【ＦＩ】
　Ｂ０１Ｄ　53/36　　ＺＡＢＧ
　Ｂ０１Ｊ　21/04　　Ａ
　Ｂ０１Ｊ　21/06　　Ａ
　Ｂ０１Ｊ　21/08　　Ａ
　Ｂ０１Ｊ　23/06　　Ａ
　Ｂ０１Ｊ　23/10　　Ａ
　Ｂ０１Ｊ　23/14　　Ａ
　Ｂ０１Ｊ　23/42　　Ａ
　Ｂ０１Ｊ　27/043　　Ａ
　Ｃ０１Ｂ　 7/19　　Ａ
　Ｃ０１Ｂ　17/45　　Ｇ
　Ｃ０１Ｂ　21/083
　Ｂ０１Ｊ　23/74　　３０１Ａ
　Ｂ０１Ｊ　23/74　　３１１Ａ
　Ｂ０１Ｊ　23/74　　３２１Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成16年12月22日(2004.12.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
フッ素化合物を含むガスの導入口と、水蒸気あるいは水の導入口とを有する予熱器と、

前記予熱器を加熱するヒーターと、前記予熱器の後段に設けられるフッ素化合物を分解する触媒を充填した反応器と、前記反応器の後段に設けられる冷却室とを有することを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理装置。

【請求項２】

請求項１に記載されたフッ素含有化合物の分解処理装置であって、

前記予熱器の前段に不純物を除去する手段を有することを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理装置。

【請求項３】

請求項２に記載されたフッ素含有化合物の分解処理装置であって、

前記不純物を除去する手段が水のスプレーであることを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理装置。

【請求項４】

請求項１ないし３のいずれかに記載されたフッ素含有化合物の分解処理装置であって、

前記予熱器に、窒素，空気あるいは酸素の導入口を有することを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理装置。

【請求項５】

請求項１ないし４のいずれかに記載されたフッ素含有化合物の分解処理装置であって、

反応器に充填された触媒及び該反応器に導入されるフッ素化合物含有ガス流の少なくとも一方をフッ素化合物が加水分解しうる温度まで加熱するための加熱手段を有することを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理装置。

【請求項６】

フッ素含有化合物を含む排ガスの導入口と、水蒸気あるいは水をガス流に対して添加する手段と、ガス流と前記触媒とを２００～８００℃の温度で接触させるために少なくとも一方を加熱する手段と、触媒を充填した反応器と、前記反応器の後段に設けられた冷却室と排ガス洗浄槽と、を有することを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理装置。

【請求項７】

触媒を充填した反応器と、該反応器で処理されるフッ素と炭素，硫黄，窒素の１つとの化合物を含むガス流に水蒸気を添加する水添加器と、該反応器に充填された触媒及び該反応器に導入されるフッ素化合物含有ガス流の少なくとも一方をフッ素化合物が加水分解しうる温度まで加熱するための加熱手段とを備えたことを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理装置。

【請求項８】

請求項７に記載の装置において、前記反応器の後段に該反応器より排出されたガス流を水で洗浄するための排ガス洗浄槽を備えたことを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理装置。

【請求項９】

請求項１ないし８のいずれかに記載されたフッ素含有化合物の分解処理装置であって、

前記ガス流に対して窒素あるいは空気あるいは酸素を供給し、ガス流中のフッ素含有化合物の濃度を調節する手段を有することを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理装置。

【請求項１０】

請求項１ないし９のいずれかに記載されたフッ素含有化合物の分解処理装置であって、

前記触媒はＡｌを含んでなる触媒であることを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理装置。

【請求項１１】

請求項１ないし１０のいずれかに記載されたフッ素含有化合物の分解処理装置であって、

前記予熱器に導入される前記水蒸気あるいは水はイオン交換樹脂で精製されていることを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理装置。

【請求項１２】

請求項１ないし１１のいずれかに記載されたフッ素含有化合物の分解処理装置であって

、
前記反応器の後段に、水のスプレー手段を有する排ガス洗浄槽を有することを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理装置。
【請求項１３】
請求項１ないし１２のいずれかに記載されたフッ素含有化合物の分解処理装置であって、
前記フッ素含有化合物としてＰＦＣを含むことを特徴とするフッ素含有化合物の分解処理装置。
【請求項１４】
フッ素含有化合物を含むガスと、水蒸気あるいは水とを予熱器で加熱し、前記ガスに含まれるフッ素含有化合物を触媒で分解し、前記フッ素含有化合物が分解されたガスを冷却することを特徴とするフッ素含有化合物の処理方法。
【請求項１５】
請求項１４に記載されたフッ素含有化合物の処理方法であって、
前記予熱器に窒素，空気あるいは酸素を供給することを特徴とするフッ素含有化合物の処理方法。
【請求項１６】
請求項１４または１５に記載されたフッ素含有化合物の処理方法であって、
前記フッ素含有化合物を含むガスを予熱器で加熱する前に、水のスプレーにより不純物を除去することを特徴とするフッ素含有化合物の処理方法。